## ヨウ化サマリウムを用いた新規タンデム型 スピロ環形成反応の開発

京都薬大¹、阪大院薬²、京大院薬³ ○岩﨑 宏樹¹、筒井 望²、江口 徹²、 恵理子<sup>1</sup>、有光 健治<sup>1</sup>、小関 稔<sup>1</sup>、大野 浩章<sup>3</sup>、田中 徹明<sup>2</sup>、山下 正行<sup>1</sup> 宮澤

ョウ化サマリウム(II)は、毒性の少ない緩和な一電子還元剤であり、その有用性からこれまでョウ化サマリ ウム(II)を用いた多彩な反応が報告されている。ヨウ化サマリウム(II)を用いた有機合成反応は官能基選択的 還元反応と還元的炭素-炭素結合形成反応に大別され、特に後者においては、多重結合に対するケチルラジカ ルの付加を用いた分子内環化反応が種々報告されている。近年、オレフィンの代わりに芳香環をラジカル受 容体とした反応が報告されているが、いずれも縮環化合物の合成であり、側鎖の根元で閉環したスピロ環化 合物を形成する反応はごくわずかであった。

一方我々は、エステル基のパラ位にカルボニル側 鎖を有する基質 1 を用いることで、高収率でスピロ 閉環体2が得られることを見出している (Scheme 1)。 また詳細な検討の結果、本反応はジエニルアニオン 中間体を経て進行することが明らかとなり、ハロゲ ン化アルキル等の適当な求電子剤を添加することで、 スピロ環形成アルキル付加体3を one-pot で得ること に成功している。なお、このとき得られた生成物は

エステル基を有する四級炭素原子に由来するジアステレオ混合物であり、本反応において二つの四級炭素部 分の相対配置は完全に制御されていることが明らかとなっている。

そこで今回、本スピロ環形成反応の応用を図るべく、その反応中間体と考えられるジエニルアニオンに着 目し、これを適当な分子内求電子体により補足する新規タンデム型スピロ環形成反応の開発に着手した。<sup>1)</sup>

まず側鎖に、求電子部位としてメチルエステル 基を有するアミド基をもつ基質4を用いて、HMPA の存在下ョウ化サマリウム(II)によるタンデム型ラ ジカル環化反応の検討を行った。その結果、目的 とする三環性スピロ環化合物 5 を得ることに成功 した (Scheme 2)。また本反応において、エステル

基のα位での開裂が確認されており、基質の分解による収率の低下が示唆された。

そこで、一炭素伸長した基質6を用いて検討を行った。その結果、目的の環化体7が中程度の収率で得ら れ、期待した通り dispiro[4.2.4.2]tetradecane 骨格形成反応と比べ、収率が向上した (Table 1, Entry 1)。次に、 収率の改善を目的に求電子体の検討を行った。求電子部位 としてフェニルエステル、シアノメチルエステル及び Weinreb アミドを有する基質を用いて検討を行った結果、 脱離能の高いフェニルエステルを有する基質 6b において メチルエステルの場合と同等の結果を得た (Table 1, Entry 2)。また、シアノメチルエステル基、Weinreb アミド基を 有する基質 6c, 6d はヨウ化サマリウム(II)に対して安定で はないため、収率の低下を招いたと推測される (Table 1, Entries 3 and 4)。本検討結果から、基質安定性の観点より、 メチルエステル基を最適な脱離機として以後の検討を行 った。

	<b>-</b>	0.1	_	Product yield (%)
_	Entry	Substrate	R	7
	1	6a	OMe	44
	2	6b	OPh	44
	3	6c	OCH <sub>2</sub> CN	11
	4	6d	NMe(OMe)	28

次に、本反応における立体障害の影響を調べる目 Table 2 的で、アミド側鎖上に置換基を有する基質を用いて 検討を行った。まず、窒素上にメチル基よりも嵩高 いイソプロピル基を有する基質8aを用いて検討を行 った。その結果、窒素上の置換基がメチル基の場合 と比べ、収率が低下した (Table 2, Entry 1)。これは、 窒素上の置換基が嵩高いと二度目の閉環の際に環化 に有利なコンホメーションをとりにくいためである と考えられる。また、エステルのα位、β位それぞ れにメチル基を導入した基質 8b、8c を用いて検討を 行った。基質 8b においては、置換基を持たない場合 と比べ収率は向上したが、基質 8c においては収率が 低下する結果となった (Table 2, Entries 2 and 3)。以上

						Product yield (%) <sup>a</sup>
Entry	Substrate	$R^1$	$R^2$	$R^3$	$R^4$	9
1	8a	<i>i</i> -Pr	Н	Н	Me	<b>9a</b> :26
2	8b	Me	Me	Н	Me	<b>9b</b> :51
3	8c	Me	Н	Me	Me	<b>9c</b> :27

<sup>a</sup> All the reactions were carried out in THF using Sml<sub>2</sub> (5 equiv.) and HMPA (18 equiv.) at -78 to 0 °C.

の結果から、エステル基の $\alpha$ 位の置換基は反応部位と近接しているため立体障害として働き、 $\beta$ 位の置換基 は反応に有利なコンホメーションをとりやすくすることに寄与している可能性がある。

さらに、ケトン側鎖上における置換基が本反応 に与える影響を調べる目的で、ケトン側鎖末端に それぞれ、エチル基、イソプロピル基及びベンジ ル基を持つ基質を用いて検討を行った。その結果、 いずれの基質においてもケトン側鎖末端がメチ ル基の場合と比べて収率は低下するものの、対応 する望みのスピロ閉環体を得ることに成功した (Table 3, Entries 1-3)。ケトン側鎖末端の置換基が 嵩高くなるにつれ収率が低下したことから、側鎖 末端の置換基が嵩高いと 1 度目の閉環が進行し にくいため、収率が低下したものと推測される。 さらに、側鎖末端を環状ケトンとした基質 11 を 用いて検討を行った。その結果、低収率ではある が、期待通りの環化が進行し、多環性化合物の一 挙合成に成功した (Table 3, Entry 4)。

Table 3				
Entry	Substrate	Product ratio (yield) <sup>a</sup>		
	O O O R	Me N R OH		
1	<b>10a</b> : R = Et	<b>12a</b> : <b>12b</b> = 29:4 (33%)		
2	<b>10b</b> : R = <i>i</i> -Pr	13a:13b = 17:3 (23%)		
3	<b>10c</b> : R = Bn	<b>14a</b> : <b>14b</b> = 15:9 (24%)		
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Me NOHO		
4	11	<b>15a</b> : <b>15b</b> = 17:3 (20%)		

 $^a$  All the reactions were carried out in THF using SmI $_2$  and HMPA at -78 to 0  $^{\circ}$ C.

最後に、スピロ環化を含むタンデム型環化反応の一環として、1 度目の環形成において縮環型中間体を与 えると予想される、アミド側鎖のメタ位にケトン側鎖を有する基 質16及び17を用いて検討を行った。その結果、1度目の環形成 が5員環、6員環いずれの場合においても、期待した通り、一度 目の環化がアミド側鎖のパラ位で進行した環化体が得られた (Scheme 3)。また、1度目の環形成における立体選択性は制御さ れており、メチル基と隣のプロトンがアンチになるように配置さ れていることを NOE により確認している。 (Scheme 3)。

## <参考文献>

1) Iwasaki, H.; Tsutsui, N.; Eguchi, T.; Ohno, H.; Yamashita, M.; Tnanaka, T. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1770-1772.